(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-91048

(P2000-91048A)

(43)公開日 平成12年3月31日(2000.3.31)

(51) Int.CL.	識別配号	FΙ		テーマコート*(参考)
HOIR	33/76	H01R	33/76	5E024
	11/01		11/01	ĸ
	13/02		13/02	

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 9 頁)

(21)出顧番号	特顧平10-262017	(71)出顧人	000004064
			日本母子株式会社
(22)出顧日	平成10年9月16日(1998.9.16)		愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号
		(71)出顧人	
			山一電機株式会社
			東京都大田区中馬込3丁目28番7号
		(72)発明者	吉岡 俊雄
			爱知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日
			本母子株式会社内
		(74)代理人	100088818
			弁理士 渡邊 一 平

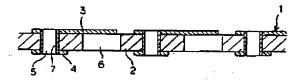
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 導通補助材及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 導通安定性及び高速性に優れるとともに、球 状端子及び平面端子の双方に適用可能であり、実装用の 集積回路用ソケットとして好適に使用できる導通補助材 を提供する。

【解決手段】 絶縁性の弾性素材からなるペースシート 2 と、ペースシート 2 の一方の表面に所定のピッチで配置された第1接触パッド3と、ペースシート 2 の他方の表面であって、ペースシート 2 を間に挟んで各第1接触パッド3の一部と重なる位置にそれぞれ配置された第2接触パッド4と、第1接触パッド3、ペースシート 2 及び第2接触パッド4を頁通する第1頁通孔5と、各第1接触パッド3の一端部が各々その開口域内に収まるようにペースシート 2 を頁通する第2 頁通孔6 とを有し、第1頁通孔5 の内周面に、第1接触パッド3と第2接触パッド4とを導通させるように導電性素材からなるメッキ7が施されている導通補助材。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ・ 絶縁性の弾性素材からなるベースシートと.

当該ベースシートの一方の表面に、所定のピッチで配置 された導電性素材の小片からなる多数の第 1 接触バッド と

前記ペースシートの他方の表面であって、前記ペースシートを間に挟んで前記各第1接触パッドの一部と重なる位置にそれぞれ配置された導電性素材の小片からなる第2接触パッドと、

前記第1接触バッド、ベースシート及び第2接触バッド を貫通する第1貫通孔と、

前記各第1接触パッドの一端部が各々その開口域内に収まるようにベースシートを貫通する第2貫通孔とを有し.

前記第1頁通孔の内周面に、前記第1接触パッドと第2接触パッドとを導通させるように導電性素材からなるメッキが施されていることを特徴とする導通補助材。

【請求項2】 前記絶縁性の弾性素材がゴム又は樹脂である請求項1記載の導通補助材。

【請求項3】 前記第1接触パッドに用いる導電性素材が、ベリリウム銅、チタン銅、銅・ニッケル・スズ合金、リン青銅、銅・ニッケル・シリコン合金、クロム銅及び銅・クロム・ジルコニウム合金よりなる群より選ばれる少なくとも1種からなる請求項1記載の導通補助材。

【請求項4】 前記第1貫通孔の内周面にメッキを施す 代わりに、当該第1貫通孔に導電性ペーストを充填して 前記第1接触バッドと第2接触バッドとを導通させるようにした請求項1記載の導通補助材。

【請求項5】 絶縁性の弾性素材からなるベースシート の両面に、導電性素材からなる導電性シートを債層する 第1工程と、

前記ベースシート及び導電性シートを貫通する第 1 貫通 孔を所定のピッチで穿設する第 2 工程と、

前記ベースシートの両面及び第1貫通孔の内周面に導電 性素材からなるメッキを崩す第3工程と、

前記ベースシートの一方の面に、前記第1貫通孔の一方の開口部をそれぞれ覆うように配置した小片状の第1レジストでマスキングを施すともに、前記ベースシートの他方の面に、前記第1貫通孔の他方の開口部をそれぞれ覆い。かつベースシートを間に挟んで前記各第1レジストの一部と重なるように配置した小片状の第2レジストでマスキングを施す第4工程と、

前記マスキングを施した以外の部分の導電性シート及び メッキを、エッチングにより除去する第5工程と、

前記第5工程でベースシートの一方の面上に残った導意 性シートの残部及びメッキの残部からなる小片の一端部 が各々その開口域内に収まるように。前記ベースシート の他方の両から、レーザー加工によりベースシートに第 2 貫通孔を形成する第6 工程とからなることを特徴とする導通補助材の製造方法。

【請求項6】 絶縁性の弾性素材からなるベースシートの一方の表面に、導電性素材からなる導電性シートを積層する第1工程と、

前記ベースシート及び導電性シートを貫通する第1貫通 孔を所定のピッチで穿設する第2工程と、

前記ペースシートの両面及び第1貫通孔の内周面に導電性素材からなるメッキを施す第3工程と、

10 前記ベースシートの導電性シートを債層した側の面に、前記第1貫通孔の一方の開口部をそれぞれ覆うように配置した小片状の第1レジストでマスキングを施すともに、前記ベースシートの他方の面に、前記第1貫通孔の他方の開口部をそれぞれ覆い、かつベースシートを間に挟んで前記各第1レジストの一部と重なるように配置した小片状の第2レジストでマスキングを施す第4工程と、

前記マスキングを施した以外の部分の導電性シート及び メッキを、エッチングにより除去する第5工程と

20 前記第5工程でベースシートの導電性シートを積層した側の面上に残った導電性シートの残部及びメッキの残部からなる小片の一端部が各々その開口域内に収まるように、前記ペースシートの導電性シートを積層していない側の面から、レーザー加工によりベースシートに第2頁通孔を形成する第6工程とからなることを特徴とする導通補助材の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の層する技術分野】 本発明は、種々の電子用機 器に用いられる導体間の接続に用いられる導通補助材及 びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】 導通補助村とは、コネクタの接続要素間に介在させることにより、接続要素間の電気的導通を助ける働きをするものであり、一般的なコネクタに使用される他、IC.LSI等の集積回路用ソケットのコンタクト基板、すなわち、集積回路と基板との導通を仲介する部分に用いられる。コンタクト基板は、集積回路の端子及び基板に形成された端子の双方とを接に接触することが、十分な電気的導通を確保するために必要である。また、実装用に用いられる集積回路用ソケットのコンタクト基板の場合には、近年の情報処理機器等の小型化の要請から内薄であるとともに、処理する情報量の増加に伴い高速性を備えることも要求される。

【0003】 従来の集積回路用のコンタクト基板として用いられる導通補助材としては、湾曲部37を形成することにより上下方向の弾性を持たせるとともに、集積回路35の球状端子(BGA)34を支持する支持部39を形成した端子接触部材45を用いるもの(図13

の他方の面から、レーザー加工によりベースシートに第 50 (a))、シリコーンゴム40中に金属細線41を高密度

で埋設したもの(図13(h))、ゴムシート42の両面 間に導電性粒子43を列状に配置してなり、集積回路3 5の球状端子34によって圧縮されることにより、その 部分の導電性粒子43が互いに接触するもの(図13 (c))、一端を巻きバネ44にて支持した端子接触部材 45を、他端がシートから突出した状態でシートに埋設 したもの(図13(d)). 導電性材料からなるワイヤー をランダムに巻いて形成した端子接触部材45を、両端 がシートから突出した状態でシートに埋設したもの(図 13(e)) 等がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら 前記 の導通補助材の内、図13(8)に示すものは、高速性に 劣ることから、実装用の巣積回路用ソケットとしては用 いることができないという問題があった。また、図13 (b)に示すものは、高速性には優れるものの、平面端子 (LGA) には道応が難しい。図13(c)に示すもの。 は、列状に配置した導電性粒子43の接触が首尾良く行 われなかったり、他の列に属する導電性粒子43が接触 する等、導通が不安定であるという問題があった。図1 20 3(d)に示すものは、その構造より肉厚にならざるを得 ないため、高速性に劣るとともに、実装用としての使用 には着さないという問題があった。更に、図13(e)に 示すものは、導通の経路に多様性があるため、電気的特 性が不安定となるという問題があった。

【0005】 本発明は、かかる状況に鑑みてなされた ものであり、その目的とするところは、導通安定性及び 高速性に優れるとともに、球状端子及び平面端子の双方 に適用可能であり、実装用の集積回路用ソケットとして 好道に使用できる導通補助付及びその製造方法を提供す 30 ることにある.

[0006]

【課題を解決するための手段】 本発明によれば、絶縁 性の弾性素材からなるベースシートと、当該ベースシー トの一方の表面に、所定のビッチで配置された導電性素 材の小片からなる多数の第1接触パッドと、前記ベース シートの他方の表面であって、前記ベースシートを聞に 挟んで前記各第1接触パッドの一部と重なる位置にそれ それ配置された導電性素材の小片からなる第2接触バッ ドと、前記第1接触パッド、ベースシート及び第2接触 40 パッドを貫通する第1貫通孔と、前記各第1接触パッド の一端部が各々その関口域内に収まるようにベースシー トを貫通する第2貫通孔とを有し、前記第1貫通孔の内 周面に、前記第1接触パッドと第2接触パッドとを導通 させるように導電性素材からなるメッキが施されている ことを特徴とする導通補助村、が提供される。

【①①①7】 また、本発明によれば、絶縁性の弾性素 材からなるベースシートの両面に、導電性素材からなる 導電性シートを積層する第1工程と、前記ペースシート 及び導電性シートを貫通する第1貫通孔を所定のピッチ 50 このベースシート2の他方の表面には、同じく導電性素

で穿設する第2工程と、前記ペースシートの両面及び第 1 貫通孔の内周面に導電性素材からなるメッキを施す第 3工程と、前記ベースシートの一方の面に、前記第1貫 通孔の一方の開□部をそれぞれ覆うように配置した小片 状の第1レジストでマスキングを施すともに、前記ペー スシートの他方の面に、前記第1貫通孔の他方の開口部 をそれぞれ覆い、かつベースシートを間に挟んで前記各 第1レジストの一部と重なるように配置した小片状の第 2レジストでマスキングを施す第4工程と、前記マスキ 10 ングを施した以外の部分の導電性シート及びメッキを、 エッチングにより除去する第5工程と、前記第5工程で ベースシートの一方の面上に残った導電性シートの残部 及びメッキの残部からなる小片の一端部が各々その開口 域内に収まるように、前記ベースシートの他方の面かり ら、レーザー加工によりベースシートに第2貫通孔を形 成する第6工程とからなることを特徴とする導通補助材 の製造方法、が提供される。

【①①①8】 更に、本発明によれば、絶縁性の弾性素 材からなるペースシートの一方の表面に、導電性素材か らなる導電性シートを精磨する第1工程と、前記ベース シート及び導電性シートを普通する第1貫通孔を所定の ピッチで穿設する第2工程と、前記ベースシートの両面 及び第1貫通孔の内周面に導電性素料からなるメッキを 施す第3工程と、前記ベースシートの導電性シートを積 **層した側の面に、前記第1貫通孔の一方の開口部をそれ** ぞれ覆うように配置した小片状の第1レジストでマスキ ングを施すともに、前記ベースシートの他方の面に、前 記第1貫通孔の他方の開口部をそれぞれ覆い、かつべー スシートを間に挟んで前記各第1レジストの一部と重な るように配置した小片状の第2レジストでマスキングを 施す第4工程と、前記マスキングを施した以外の部分の 導電性シート及びメッキを、エッチングにより除去する 第5工程と、前記第5工程でベースシートの導電性シー トを積層した側の面上に残った導電性シートの残部及び メッキの残部からなる小片の一端部が各々その開口域内 に収まるように、前記ペースシートの導電性シートを積 層していない側の面から、レーザー加工によりベースシ ートに第2貫通孔を形成する第6工程とからなることを 特徴とする導通補助材の製造方法、が提供される。

[0009]

【発明の実施の形態】 以下、本発明の実施形態を図面 に基づいて説明する。図1は本発明の導通補助材の一例 を示す平面図 図2はそのA部を拡大した平面図 図3 は図2を反対側の面から見た平面図、図4は図2の1-1線に沿って切断した断面図である。

【① ① 】 () 】 とれらの図に示すように、本発明の導通 補助材1は、絶縁性の弾性素材からなるベースシート2 の一方の表面に、導電性素材の小片からなる多数の第1 接触バッド3が所定のピッチで配置されている。また、

材の小片からなる第2接触バッド4が、ベースシート2 を間に挟んで各第1接触バッド3の一部と重なる位置に それぞれ配置されている。

【0011】 更に、この導通補助付1には、第1接触 パッド3、ベースシート2及び第2接触パッド4を貫通 する第1貫通孔5と、各第1接触パッド3の一端部が各 々その開□域内に収まるようにベースシート2を貫通す る第2貫通孔6とが形成されている。第1貫通孔5の内 周面には、第1接触パッド3と第2接触パッド4とを導 いる。第2頁通孔6の開口域内に延出している第1接触 パッド3の一端部は、ベースシート2に対して自由端を 形成し、当該開口域内においてベースシート2の厚み方 向に弾性変位可能となっている。

【0012】 なお、本発明においては、図5に示すよ うに、第1貫通孔5の内周面にメッキを施す代わりに、 当該第1貫通孔5に導電性ペースト8を充填して第1接 触パッド3と第2接触パッド4とを導通させるようにし てもよい。また、図6に示すように、ベースシート2の 第1接触パッド3を配置した側の面には、第2貫通孔6 20 の開口域内に延出している第1接触バッド3の一端部の 表面を除いて、ポリイミドフィルム等の樹脂フィルムか ちなる保護膜9を形成し、ベースシート2と第1接触パ ッド3との密着性を向上させ、両者の剥離を防止するよ うにしてもよい。

【0013】 更に、第1接触パッド3、第2接触パッ ド4及び第1貫通孔5内周面の露出部分には、腐食防 止、接触安定性の向上等の目的で耐腐食性素材からなる 仕上げメッキ10が施こされていることが好ましい。こ の仕上げメッキに好適な耐腐食性素材としては、金、 銀。ニッケル、錫、ハンダ等が挙げられ、特に金が好ま しい。

【10014】 本発明の導通補助材は、コネクタを構成 する接続要素間に介在し、第1接触バッドが一方の接続 要素の導通面に、第2接触バッドが他方の接続要素の導 通面に接触するように設置して使用され、コネクタの固 着具等により、接続要素の導通面が導通補助材に圧着 し、導通が確実となる。

【0015】 本発明の導通補助材を、集積回路と基板 間に代表される電子部品間に介在させた場合において、 図7に示すように、集積回路に代表される電子部品11 の端子12を、第1接触バッド3に接触させつつ第2貫 通孔6の内部方向へ押しつけると、第1接触パッド3は 第2貫通孔6の開口域内でベースシート2の厚み方向に 弾性変位し、その反力で端子12に弾性的に加圧接触す る。このように、この導通補助材を集積回路に代表され る電子部品との接触に供することによって良好な弾力的 加圧接触を得ることができる。

【0016】 なお、基板に代表されるもう一方の電子 部品の端子は、ベースシート2の第1接触パッド3が配 50 置された面と反対側の面に配置された第2接触バッド4 に接触されるが、第1接触バッド3と第2接触バッド4 とは、前記のとおり第1貫通孔5の内周面に施されたメ ッキ7によって導通が確保されているので、それぞれに 接触した電子部品の導通を安定的に仲介できる。また、 この導通補助付1は、その構造上、ベースシート2を肉 薄にすることができるので、実装用の集積回路用ソケッ トに求められる高速性を満たすことが可能である。

6

【0017】 図8は、本発明の導通補助材の変形例 通させるように導意性素材からなるメッキ7が施されて「10」で、第2貫通孔6の開口域内に延出している第1接触バ ッド3の一端部を、第2貫通孔6の開口部から遠ざかる 方向へと傾斜させたものである。このように第1接触バ ッド3の一端部を傾斜させると、図9のように平面端子 13を持った電子部品11に対しても良好な加圧接触状 態を得ることができる。

> 【りり18】 本発明において、ベースシートに用いち れる絶縁性の弾性素材としては、耐熱性や耐候性に優れ たものが好ましく、シリコンゴム、合成ゴム等のゴム、 又はポリマー、ポリイミド、エンジニアリング樹脂等の 樹脂が用いられるが、ボリイミド樹脂が特に好道に用い ちれる。

> 【0019】 ベースシートの厚さは、0、03~0、 63mmであることが好ましく、()、() 7~()、17m mであることがより好ましい。O. O3mmより薄い場 台には機械的強度が低くなり耐久性に問題が生じる。一 方。(). 63mmより厚い場合には、コネクタの接続要 素間に介在させることが困難となる。

【0020】 また、第1接触パッドに用いる導電性素 材には、導電性の他、耐摩耗性、可換性、耐酸化性、強 度等が要求され、ベリリウム銅、チタン銅、銅・ニッケ ル・スズ合金。リン青銅。銅・ニッケル・シリコン合 金、クロム銅及び銅・クロム・ジルコニウム合金よりな る群より選ばれる少なくとも1種が好ましく用いられ る。第2接触バッドに用いる導電性素材は、導電性の他 に耐酸化性が要求されるだけなので、第1接触バッドと 同じ材料でもよいが、銅等が好ましく用いられる。第1 貫通孔内周面のメッキに用いる導電性素材には、銅等が 好ましく用いられる。

【0021】 上記のうち、第1接触バッドの導電性素 40 材としてベリリウム銅を用いた場合には、本発明の導通 補助材に疲労特性及び耐熱性を付与することができ、バ ーンインテスト用の集積回路検査器具のコンタクト基板 として用いることも可能となる。したがって、本発明で はベリリウム銅。あるいはベリリウム銅と同等の特性を 有する素材が特に好ましく用いられる。ベリリウム銅の 導電性は、その組成にもよるが、純銅に対し20~60 %で十分な導電性を有するとともに、ビッカース硬さ が、銅が80~100なのに対し、ベリリウム銅は25 0~400であり、耐摩耗性に優れることがわかる。

【0022】 導電性素材としてベリリウム銅を用いる

場合、その組成としては、銅を主成分とする総量におい てベリリウムを0.2~3重量%、ニッケルとコバルト を合わせて0.1~3重量%、アルミニウム、ケイ素、 鉄、チタン、スズ、マグネシウム、マンガン、亜鉛又は インジウムからなる群より選択した1以上の元素を合わ せてり、05~3重量%含有することが好ましいが、そ れぞれ、1.6~2重量%。0.2~1重量%。0.0 5~1 重量%含有することがより好ましく、1.6~2 重量%、(). 2~(). 6重量%、(). ()5~1重量%含 有することが更に好ましい。

【0023】 ベリリウム含量が3重量%より大きい場 台は、導電性が低下し好ましくない。また、ベリリウム 含量は2重量%より大きくしても、それに見合うだけの 強度の上昇が得られず不経済となる。一方、(). 2 重量 %未満の場合には、強度が不足する。また、ニッケルと コバルトの総計が3重量%より大きいと導電性が低下 し、0.2重量%未満の場合にはベリリウムの添加によ る強度の上昇が抑えられ、ベリリウムの添加量を更に多 くしなければならない。更に、アルミニウムその他の元 素の総置が3重量%より大きい場合には、導電性が低下 20 し、0.05重量%未満の場合には、特に高温での強度 が不足する。

【0024】 導通部材としての第1接触パッドの厚さ は、0.01~0.1mmであることが好ましく。0. () 2~(). () 5 mmであることがより好ましい。(). () 1 mm未満の場合は、強度が小さ過ぎて電子部品に対す る適度な接触加重を得ることが困難となり、O.lmm を超える場合は、強度が大きくなりすぎて安定した接触 加重を得ることが困難となるからである。第2パッドに ついては、特に厚さは限定されず、基板等との接触を得 30 るのに必要な道度な厚みがあればよい。

【()()25】 次に、本発明の製造方法について説明す る。本発明の製造方法は、上記導通補助材を製造するた めの代表的な例であって、以下の各工程からなる。

【0026】 まず、第1工程においては、図10(a) に示すように、絶縁性の弾性素材からなるベースシート 2の両面に、それぞれ導電性素材からなる導電性シート 14.15を積層する。具体的な積層の方法としては、 例えば、熱硬化性接着剤又は熱可塑性接着剤を塗布した スにより接着に必要な温度、圧力及び時間を与えてもよ く、また、予熱後、熱ロールで精層してもよい。熱ロー ルで種居する場合において熱硬化性接着剤を使用すると きは、更にその後適切な温度と時間を与えてキュアーす

【0027】 なお、ベースシート2の両面に積層する 導電性シート14、15の材質は異なるものであっても よく、例えば、最終的に第1接触パッドが形成される側 の面に積層される導電性シート 1.4には可撓性に富むべ に積層される導電性シート15には銅を用いるというよ うにしてもよい。

【0028】 第2工程では、図10(b)に示すよう に、第1工程にて積層したベースシート2及び導電性シ ート14、15貫通する第1貫通孔5を所定のビッチで 穿設する。穿設の方法としては、打ち抜き、ドリル加 工、レーザー加工等を用いることができる。

【0029】 第3工程では、図10(c)に示すよう に、ベースシート2の両面及び第1貫通孔5の内周面 に、銅等の導電性素材からなるメッキ16を施す。具体 的なメッキの方法としては、例えば無電解銅メッキや電 解銅メッキが挙げられる。電解銅メッキで行う場合に は、先に無電解銅メッキと類似のパラジウム触媒層を形 成しておくことが肝要である。なお、第3工程において は、第1百通孔5の内周面に導電性素材からなるメッキ 16を施す代わりに、当該第1貫通孔5に導電性ペース トを充填するようにしてもよい。

【0030】 続く第4工程では、図10(d)に示すよ うに、ベースシート2の一方の面に、第1頁通孔5の一 方の開口部をそれぞれ覆うように配置した小片状の第1 レジスト17でマスキングを施す。また、ベースシート 2の他方の面に、第1貫通孔5の他方の関口部をそれぞ れ覆い、かつベースシート2を間に挟んで各第1レジス ト17の一部と重なるように配置した小片状の第2レジ スト18でマスキングを施す。

[10031] 具体的には、第3工程にてメッキ16を 施したベースシート2上に感光性レジストシートを貼 り、その上に前記第1レジスト17又は第2レジスト1 8のパターンのポジフィルムを載せて露光し、現像処理 によりパターン以外の部分のレジストを除去する。

【0032】 第5工程では、第4工程にてマスキング を施した以外の部分の導電性シート及びメッキを、エッ チングにより除去する。エッチング液としては、塩化第 二銅溶液や塩化第二鉄溶液が用いられ、これに前記マス キングを施したベースシートを浸漬することにより、第 1レジスト及び第2レジストが付着していない部分の導 **電性シート及びメッキが除去される。**

【0033】 エッチング終了後、図10(e)に示すよ うに、ベースシート2の一方の表面に残った導電性シー ベースシートと導電性シートとを重ね合わせ、熱板プレ 40 トの残部14aとその表面のメッキの残部16aとから なる小片19は、一体となって第1接触パッドを構成 し、ベースシート2の他方の表面に残った導電性シート の残部15 a とその表面のメッキの残部16 b とからな る小片20は、一体となって第2接触パッドを構成す る。そして、これら第1及び第2接触バッドは、第1貫 通孔5内周面に施されたメッキ16c(又は第1貫通孔 5に充填された導電性ペースト)により導通が確保され た状態となっている。

【0034】 第6工程では、図10(1)に示すよう リリウム銅を用い、第2接触パッドが形成される側の面 50 に、第5工程でベースシート2の一方の面上に残った導 電性シートの残部14 a及びメッキの残部16 aからなる小片19 (第1接触パッド)の一端部が各々その開口域内に収まるように、ベースシート2の他方の面から、レーザー加工によりベースシート2に第2貫通孔6を形成する。

[0035] ここで、レーザー加工により第2貫通孔6の形成を行うのは、ベースシート2から第2貫通孔6に相当する部分のみを除去し、当該第2貫通孔6の閉口域内に第1接触バッドとなる小片19の一端部が残るようにするためである。第2貫通孔6の形成に打ち抜き等の機械的加工法を用いた場合には、ベースシート2の第2貫通孔相当部分のみならず、その開口域内に残すべき小片19の一端部まで一緒に切除される。これに対し、レーザー加工では、その加工条件を調整することにより、ベースシート2のみに加工を施すことが可能である。

[0036] レーザー加工の具体的な加工条件としては、例えば、ベースシートがポリイミド樹脂製で、その厚みが125μ程度の場合には、エキシマレーザーを使用し、最小液長248nmで3秒程度照射する。レーザ 20一の種類はエキシマレーザーに限定されるものではないが、ポリイミドだけを除去し第1接触バッドとなる小片を変質しないで残すためには、レーザー光のエネルギーを適切に制御することが大切であり、そのような制御がしやすいエキシマレーザーを用いるのはより好ましい方法といえる。また、小さな孔径の寸法精度を得るためにも直進性の良いエキシマレーザーは好査である。

【0037】 この第6工程が終了すると、第1接触パッドを構成する小片19の一端部が、各第2貫通孔6の開口域内に延出された状態が得られる。すなわち、小片 3019の一端部は、第2貫通孔6の開口域内に片持ち状に突き出されて自由端を形成し、この開口域内においてベースシート2の厚み方向に自由に撓むことができるようになる。

【0038】 なお、図6のように、ベースシート2と 第1接触パッド3との奄着性を向上させる目的で樹脂フィルムからなる保護膜9を形成したい場合には、前記第 6工程に先立って、図11(a)に示すように、ベースシート2の一方の面にポリイミドフィルム等の樹脂フィルム21を被覆した後、第6工程における第2貫通孔6の 40 形成に加えて、更に図11(b)のように、第2貫通孔6 の開口域内に延出している小片19の一端部の表面に被 覆された樹脂フィルムを除去し、当該小片19の一端部を露出させる。

【0039】 樹脂フィルムの除去には、第2貫通孔の形成と同様にレーザー加工を用いることができ、ベースシート2の樹脂フィルム21を被覆した側の面から、小片19の一端部の表面に被覆された樹脂フィルムのみを除去できるようにレーザー光のエネルギーを調整して実施する。

【0040】 また、図11(c)のように、第1接触バッドとなる小片19、第2接触パッドとなる小片20及び第1頁通孔5内周面の露出部分に、腐食防止、接触安定性の向上等の目的で全等の耐腐食性素材からなる仕上げメッキ10を施ごしてもよい。具体的なメッキの方法としては、電気メッキによる方法が好適に用いられる。【0041】 続いて、本発明の他の製造方法について説明する。なお、以下の各工程における積層、穿設、メッキ、エッチング等の具体的方法の内、先述の製造方法と同様の方法が適用できる部分については、その説明を省略する。

【0042】 まず、第1工程においては、図12(a) に示すように、 絶縁性の弾性素材からなるベースシート 2の一方の表面に、ベリリウム銅等の導電性素材からなる導電性シート22を積層する。

[0043] 第2工程では、図12(b)に示すよう に、第1工程にて積層したベースシート2及び導電性シ ート22を貫通する第1貫通孔5を所定のピッチで穿設 する。

【① ① 4 4 】 第3工程では、図12(c)に示すように、ベースシート2の両面及び第1貫通孔5の内周面に、鋼等の導電性素材からなるメッキ23を施す。なお、ベースシート2の導電性シートを積層してない側の面には、メッキ層との奄着性を良くするため、メッキを行う前に、ブラズマエッチング加工やスパッタリング加工などによる租面化処理を施しておくことが好ました。【① 0 4 5 】 続く第4工程では、図12(d)に示すように、ベースシート2の導電性シート22を結層した小片状の第1レジスト24でマスキングを施す。また、ベースシート2の他方の面に、第1貫通孔5の他方の間口部をそれぞれ覆い、かつベースシート2を間に挟んで各第1レジスト24の一部と重なるように配置した小片状の第2レジスト25でマスキングを施す。

[0046] 第5工程では、第4工程にてマスキングを施した以外の部分の導電性シート及びメッキを、エッチングにより除去する。エッチング終了後、図12(e)に示すように、ベースシート2の一方の表面に残った導電性シートの残部22aとその表面のメッキの残部23aとからなる小片26は、一体となって第1接触パッドを構成し、ベースシート2の他方の表面に残ったメッキの残部23bは、第2接触パッドを構成する。そして、これら第1及び第2接触パッドは、第1貫通孔5内周面に描されたメッキ23cにより導通が確保された状態となっている。

【0047】 第6工程では、図12(f)に示すよう に、第5工程でベースシート2の導電性シートを積層し た側の面上に残った導電性シートの残部22a及びメッ 50 キの残部12aからなる小片26(第1接触パッド)の 一端部が各々その開口域内に収まるように、ベースシー ト2の導電性シートを積磨していない側の面から、レー ザー加工によりベースシート2に第2貫通孔6を形成す る.

11

【10048】 この第6工程が終了すると、第1接触バ ッドを構成する小片26の一端部が、各第2貫通孔6の 開口域内に延出された状態が得られる。すなわち、小片 26の一端部は、第2貫通孔6の開口域内に片持ち状に 突き出されて自由端を形成し、この開口域内においてべ ースシート2の厚み方向に自由に撓むことができるよう。 になる。

【0049】 なお、この製造方法においても、先述の 製造方法と同様に、第1貫通孔5の内周面に導電性素材 からなるメッキ23を施す代わりに、当該第1貫通孔5 に導電性ペーストを充填するようにしたり、ベースシー ト2と第1接触バッド3との密着性を向上させる目的で 保護膜を形成したり、金等の耐腐食性素材からなる仕上 げメッキが施こしたりしてもよい。

[0050]

【発明の効果】 以上説明したように、本発明の導通補 20 助材は、導通安定性及び高速性に優れるとともに、球状 端子及び平面端子の双方に適用可能であり、実装用の集 **精回路用ソケット等に好道に使用することができる。ま** た。本発明の製造方法によれば、このような優れた特徴 を有する導通補助材を効率よく製造することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の導通補助材の一例を示す平面図であ る。

- 【図2】 図1のA部を拡大した平面図である。
- [図3] 図2を反対側の面から見た平面図である。
- [図4] 図2の1-1線に沿って切断した断面図であ る.
- 【図5】 本発明の導通補助材の他の一例を示す平面図 である。
- 【図6】 本発明の導通補助材の更に他の一例を示す平米

* 面図である。

【図?】 第1接触パッドと電子部品の端子との接触状 態を示す断面図である。

[図8] 本発明の導通補助材の変形例を示す断面図で ある.

【図9】 図8の変形例において、第1接触バッドと電 子部品の端子との加圧接触状態を示す断面図である。

【図10】 本発明の導通補助材の製造方法の一例を示 す断面図で、(a)が第1工程、(b)が第2工程。(c)が 10 第3工程、(d)が第4工程。(e)が第5工程、(f)が第 6工程の様子を示している。

【図11】 本発明の導通補助材の製造方法の追加工程 を示す断面図である。

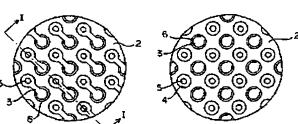
【図12】 本発明の導通補助材の製造方法の他の一例 を示す断面図で、(a)が第1工程、(b)が第2工程、 (c)が第3工程。(d)が第4工程、(e)が第5工程、 (1)が第6工程の様子を示している。

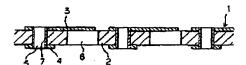
【図13】 従来の集積回路用ソケットのコンタクト基 板に用いられていた導通補助材を示す模式断面図であ る。

【符号の説明】

1…導通補助付、2…ベースシート、3…第1接触バッ ド. 4…第2接触パッド. 5…第1貫通孔、6…第2貫 通孔. 7 …メッキ、8 …導電性ペースト、9 …保護膜、 10…仕上げメッキ、11…電子部品、12…球状端 子. 13…平面端子、14…導電性シート、15…導電 性シート、16…メッキ、17…第1レジスト、18… 第2レジスト、19…小片、20小片、21…樹脂フィ ルム、22…導電性シート、23…メッキ、24…第1 レジスト、25…第2レジスト、26…小片、34…球 状端子、35…集積回路、37…湾曲部、39…端子の 支持部、40…シリコーンゴム、41…金属細線、42 …ゴムシート、43…導電性粒子、44…巻きバネ、4 5…端子接触部材。

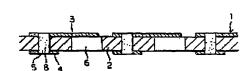
[図3] [図2]

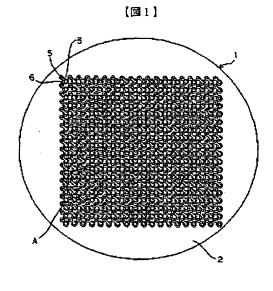


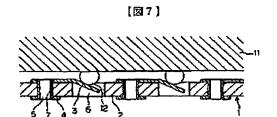


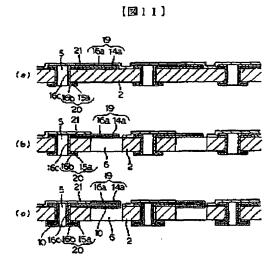
[図4]

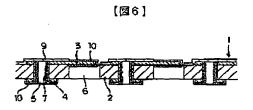
[図5]

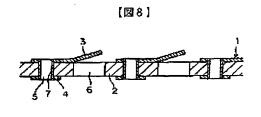


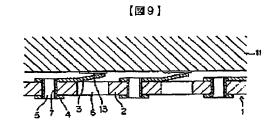




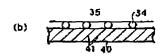




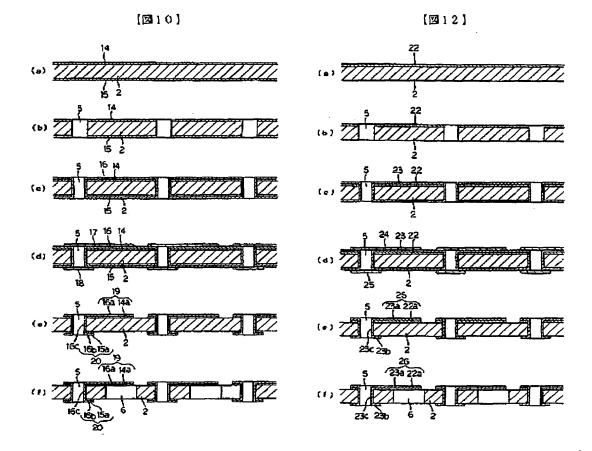












フロントページの続き

(72)発明者 井上 和義

受知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日 本碍子株式会社内

(72)発明者 浦辻 一美

東京都大田区中馬込3丁目28番7号 山一

電機株式会社内

(72)発明者 鈴木 勝己

東京都大田区中馬込3丁目28番7号 山一

電機株式会社内

(72)発明者 阿部 俊司

東京都大田区中馬込3丁目28番7号 山一

電機株式会社内

Fターム(参考) 5E024 CA30 CB04